ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

สมบัติทางไฟฟ้าของแผ่นฟิล์มหนา

YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-×</sub>

ชื่อผู้เชียน

นายดวง ทองคำชุ่ย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการสอนฟิสิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบการค้นคว้าแบบอิสระเชิงวิทยานิพนธ์

นศ.ดร.ศรีเพ็ญ ท้าวตา รศ.สุภาพ ณ เชียงใหม่ รศ.ดร.ผ่องศรี มังกรทอง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

## บทศัตราก

ในงานวิจัยนี้ ได้ เตรียมแผ่นฟิล์มหนา YBa,Cu,O,-x ด้วยวิธีปฏิกิริยาของ แข็ง (Solid Reaction) โดยใช้สาร Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, BaCO<sub>3</sub> และCuO ด้วยสัดส่วนจำนวนอะตอม Y:Ba:Cu = 1:2:3 ผสมกับ Ethylene Glycol (HOCH\_CH\_OH) ฉาบของผสมเนื้อ เดียวนี้ลงบนแผ่นรองรับอะลูมินาโดยการทา(Painting) หรือการพิมพ์(Screen Printing) และเผาที่อุณหภูมิ 890 ถึง 1000°C การฉาบจะทำ 1,2 หรือ 3 ครั้ง สำหรับครั้งที่ 2 และ 3 นั้นเผาที่อุณหภูมิช่วง 890 ถึง 1030°C ในบรรยากาศออกซิเจน แผ่นฟิล์มหนาที่เตรียมได้ มีความหนา 0.17 ถึง 0.35 มิลลิเมตร ผงของแผ่นฟิล์มนี้แสดงปรากฏการณ์ไมซ์สเนอร์ที่อุณหภูมิ สูงกว่าจุดเดือดของ ในโตรเจนเหลว การวัดความต้านทานของแผ่นนิล์มที่อุณหภูมิต่างๆ แสดงว่ามี อุณหภูมิวิกฤตที่ 80 ถึง 90K แผ่นฟิล์มที่เผาที่อุณหภูมิ 950 ถึง 980°C จะมีการยึดเกาะกัน กับแผ่นรองรับได้ดีและมีอุณหภูมิวิกฤตสูง การวิเคราะห์ผลจากการเลี้ยวเบนซองรังสีเอกซ์ พบว่า มีโครงสร้างเป็นแบบออร์โทรอมบิกเพอรอฟสไกต์และมีพารามิเตอร์แลตทิช 3.92A°, b = 3.68A° - 3.83A° uar c = 11.45A° - 11.70A°

Research Title

Electrical Property of Thick Film YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub>

**Author** 

Mr. Daung Tongcumzuy

M.S.

Teaching Physics

Examining Committee

Assist.Prof.Dr.Sripen Towta

Chairman

Assoc.Prof Suparp Na Chiangmai

Member

Assoc. Prof. Dr. Pongsri Mangkorntong

Member

## Abstract

In this research, YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-x</sub> thick films were prepared by solid reaction method. Powders of  $Y_2O_3$ ,  $Ba_2CO_3$  and CuO with atomic composition of Y:Ba:Cu = 1:2:3 were mixed with ethylene glycol (HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH). This homogeneous paste was coated on alumina substrates by painting or screen printing method. The coated substrates were heated at temperature range of 980-1000°C. The coating was carried out 1,2 and 3 times. The and 3<sup>nd</sup> coating were heated in temperature range of 980-1030°C in oxygen atmosphere. The thickness of these films were 0.17-0.35 mm. Thick film powders showed Meissner effect at higher than the boiling point of liquid nitrogen. temperature Resistivity measurement as a function of temperature indicated critical temperature range of 80 to 90K. Thick films heated in temperature range of 950 to 980°C were found to have good adhesion to alumina substrates and high critical temperature . X-ray diffraction analysis indicates that the thick film structure were orthorhombic perovskite with lattice parameter a = 3.87 to 3.92A°, b = 3.68 to 3.83A° and c =11.45 to 11.70A°.